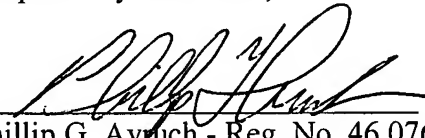


REMARKS

Claims 2-4 are cancelled. Claims 5-32 have been added. Please enter the Preliminary Amendment prior to calculating the filing fee. Examination of the amended application is respectfully requested.

Respectfully submitted,

December 26, 2001  
Date

  
Phillip G. Avrich - Reg. No. 46,076  
RABIN & BERDO, P.C.  
Telephone: 202-659-1915  
Telefax: 202-659-1898  
CUSTOMER NO. 23995

SMR:tlc

RECEIVED

A

**MARKED VERSION OF AMENDED CLAIM**

1. (Amended) A method of forming a resist pattern on a semiconductor substrate, comprising [the steps of]:

forming a resist film on the semiconductor substrate;

supplying a developing solution [onto] on the resist film to remove the resist film, wherein a portion of the resist film remains on the semiconductor substrate; and

[submerging the substrate and the resist film formed thereon in a rinsing liquid kept in a rinsing tank; and

applying ultrasonic vibration to the rinsing liquid to rinse the developing solution from the resist film submerged in the rinsing liquid]

rinsing the developing solution from the portion of the resist film by a rinsing liquid to which ultrasonic vibration is applied.

Verfahren	16
Verfahren	17
Verfahren	18
Verfahren	19
Verfahren	20
Verfahren	21
Verfahren	22
Verfahren	23
Verfahren	24
Verfahren	25
Verfahren	26
Verfahren	27
Verfahren	28
Verfahren	29
Verfahren	30
Verfahren	31
Verfahren	32
Verfahren	33
Verfahren	34
Verfahren	35
Verfahren	36
Verfahren	37
Verfahren	38
Verfahren	39
Verfahren	40
Verfahren	41
Verfahren	42
Verfahren	43
Verfahren	44
Verfahren	45
Verfahren	46
Verfahren	47
Verfahren	48
Verfahren	49
Verfahren	50
Verfahren	51
Verfahren	52
Verfahren	53
Verfahren	54
Verfahren	55
Verfahren	56
Verfahren	57
Verfahren	58
Verfahren	59
Verfahren	60
Verfahren	61
Verfahren	62
Verfahren	63
Verfahren	64
Verfahren	65
Verfahren	66
Verfahren	67
Verfahren	68
Verfahren	69
Verfahren	70
Verfahren	71
Verfahren	72
Verfahren	73
Verfahren	74
Verfahren	75
Verfahren	76
Verfahren	77
Verfahren	78
Verfahren	79
Verfahren	80
Verfahren	81
Verfahren	82
Verfahren	83
Verfahren	84
Verfahren	85
Verfahren	86
Verfahren	87
Verfahren	88
Verfahren	89
Verfahren	90
Verfahren	91
Verfahren	92
Verfahren	93
Verfahren	94
Verfahren	95
Verfahren	96
Verfahren	97
Verfahren	98
Verfahren	99
Verfahren	100

A